## 金(111)面におけるペリレンと臭素の相互作用 ~ドーピングおよびカップリング反応

Interaction between bromine and perylene on Au(111): Doping and successive coupling reaction

遠藤 理<sup>1\*</sup>、田 旺帝<sup>2</sup>、中村 将志<sup>3</sup>、雨宮 健太<sup>4</sup> 1.東京農工工、〒184-8588 小金井市中町 2-24-16 2.国際基督教大学、〒181-8585 三鷹市大沢 3-10-2 3.千葉大工、〒263-8522 千葉市稲毛区弥生町 1-33 4. KEK-PF、〒305-0801 つくば市大穂 1-1 O. Endo<sup>1\*</sup>, Wang-Jae Chun<sup>2</sup>, M. Nakamura<sup>3</sup>, K. Amemiya<sup>4</sup>

1. Department of Organic and Polymer Materials Chemistry, Faculty of Engineering,

Tokyo University of Agriculture and Technology, Koganei, Tokyo 184-8588, Japan

2. International Christian University, Tokyo 181-8585, Japan

3. Department of Applied Chemistry and Biotechnology, Faculty of Engineering, Chiba University,

Inage-ku, Chiba 263-8522, Japan

4. Photon Factory, IMSS, KEK, Tsukuba, Ibaraki 305-0801, Japan

1 <u>はじめに</u>

有機化合物は軽量であり柔軟性があること、大面 積の試料をプリンティングなどの手法によって容易 に作成できることなどから、近年デバイス材料とし ての重要性が増している。一般的に有機半導体のキ ャリアは空間的に広がったπ電子系にドーピングに よって導入されるホールや電子である。そのため効 率的なドーピングの手法とπ電子系の空間的な広が り方の制御が良質な電気物性を示す材料作成の課題 となる。

臭素ドープペリレンは最も初期に報告された有機 半導体であり、臭素によってペリレンの抵抗率は数 Ωcm まで低下する[1]。臭素との相互作用によって ペリレンから電子が移動し、導入されたホールがキ ャリアとなったと考えられる。一方臭素は水素と容 易に置換するため、ドースした試料の抵抗率は時間 とともに増加することも報告されている[2]。臭素化 したペリレンは臭素がカップリング反応の起点とな って極細グラフェンナノリボン(GNR)へと変換され る[3]。このような GNR はπ電子共役系を共有結合 によって一次元的に拡張し伝導性を増加させた材料 とみることもできる。臭素化とカップリング反応を 交互に進行させることによって、GNR の長さを伸長 させることが可能となると期待される。

そこで本課題では金(111)面に作成したペリレン単 分子層に臭素を導入することによって生じる変化を 炭素 K 吸収端近傍 X 線吸収微細構造分光法(C K-NEXAFS 法)によって明らかとすることを目的とし て実験を行った。臭素によるホールの生成、単分子 層における分子配向の変化、臭素化、加熱によるカ ップリング反応の各過程を追跡した。 2 <u>実</u>験

実験は KEK-PF の軟 X 線分光ステーション BL-7A で行った。超高真空中で Ar+スパッタ(1.5 keV)およ びアニール(ca. 800 K)によって清浄化した金(111)面 に室温でペリレンを蒸着した。蒸着量は膜厚計によ ってモニターした。 臭素は AgBr を電解することに よって発生させた。ドース量として電気量 10 μA × 300 s = 3 mC を1単位とした。この電気量に対応す る Br2分子の発生量はおよそ 1×10<sup>16</sup> ケであり金(111) 面における臭素の飽和吸着量(ca. 0.49 ML=6.8 × 10<sup>14</sup> atom/cm<sup>2</sup>[4])の約 15 倍に相当する。臭素ドース後 350 K-600 K に加熱した。C K-NEXAFS 測定は MCP によって部分電子収量法で行った。阻止電位は 200 V とした。直線偏光した入射光を入射角 90°(直入射、 NI)、55°(魔法角入射、MI)、15°(斜入射、GI)で入射 した。入射光強度 Io は上流の金メッシュの光電流で 測定した。入射光のエネルギーはグラファイトの 1s→π<sup>\*</sup>cc 遷移(π<sup>\*</sup>cc 遷移)のピーク位置(285.5 eV)で較 正した。測定は全て室温で行った。

3 結果および考察

図 1 に金(111)面におけるペリレン単分子層の C K-NEXAFS スペクトルを示す。285 eV 付近の吸収バ ンドは  $\pi^*cc$  遷移(LUMO および LUMO+1 への遷移) に帰属され[5]、GI で強調されていることから分子 面が基板表面に平行な分子配向であることを示して いる。288 eV 付近の構造は  $\sigma^*cH/R$  遷移(R は Rydberg 状態)および  $\pi^*cc$  遷移に帰属され、292 eV 付近の小 さなこぶ状の吸収および 310 eV 付近までのブロー ドな吸収は  $\sigma^*cc$  遷移に帰属される。 $\sigma^*cc$  遷移は主と して NI で強調されており、分子面が基板に平行で あることと対応している。金(111)面におけるペリレ ン分子の並行配向は低速電子線回折(LEED)や走査ト ンネル顕微鏡観察(STM)の結果と一致している[6–8]。 図2は臭素を5単位ドースした後のCK-NEXAFS スペクトルである。285 eV付近の π<sup>\*</sup>cc遷移が NIで も観測されており、全体的なスペクトルの偏光依存 が小さくなったことから、分子配向がランダムにな ったことが示唆される。また 283 eV に新たに吸収 が観測されている。この吸収はペリレンの HOMO から電子が臭素に移動した結果生じた空状態(singly unoccupied molecular orbital, SUMO)への遷移に帰属 される。実際アントラセンのラジカルカチオンに対 するスペクトルのシミュレーション結果では同様の 位置に吸収が現れることが示されている[9]。

図 3 に臭素ドースによる GI スペクトルの吸収端 領域の変化を示す。臭素 3 単位までのドースでは右 側の矢印が示すように吸収端立ち上がり位置の低エ ネルギーシフトが生じていることが分かる。このエ ネルギーシフトはペリレン単分子層上に吸着した臭 素分子の双極子によって部分的な電荷移動が生じた 結果生じたものと考えられ、臭素の量に応じて部分 的な電荷移動と完全な電荷移動の二段階でドーピン グが進行することを示していると考えられる。

図4に臭素ドース後350Kまで加熱した後のスペ クトルを示す。図1のスペクトルと同様の偏光依存 が現れており、分子面が再び基板に平行な配向とな っていることを示している。高エネルギー側で見か けの吸収強度が上昇しているが、一部の分子が脱離 した結果基板表面が露出し、金の光電子の寄与が増 加したためと考えられる。図5に350Kと450Kに 加熱後の GI スペクトルの吸収端領域の変化を示す。 350 K では SUMO への遷移が観測されており、臭化 ペリレンもカチオンの状態のままであると推測され る。450 K への加熱後は SUMO への遷移は消失して いることに加え LUMO への遷移の立ち上がり位置 が低エネルギーシフトし、LUMO+1への遷移との強 度比が変化している。これはペリレンがカップリン グ反応を起こし、共役系が拡張したことにより LUMO のエネルギーレベルが低下したことに対応す ると考えられる。SUMO への遷移は観測されてない ことから、生成物はカチオンの状態にはないと考え られる。試料を 600 K まで加熱したところ、さらに 一部の分子が脱離したがスペクトルの形状はあまり 変化しなかった。一方ペリレン単分子層を 600 K ま で加熱した場合、分子は全て脱離した。これらの結 果は臭素ドース後の加熱でカップリング反応によっ て分子量が増大した生成物が得られていることを裏 付けていると考えられる。

## 4 <u>まとめ</u>

金(111)面に形成したペリレン単分子層に臭素をド ースした後 600 K まで加熱し C K-NEXAFS スペクト ル測定を行った。臭素ドースによってペリレンがラ ジカルカチオンとなったことを示す SUMO への遷 移が現れた。450 K 以上への加熱によってカップリ ング反応が進行したことを示す LUMO への遷移の エネルギー低下が観測された。 参考文献

- [1] H. Akamatsu, et al., Nature, 173(1954)168.
- [2] H. Akamatsu et al., Bull. Chem. Soc. Jpn. 29(1956)213.
- [3] A. Kimoucheet al., Nature Comm. 6(2015)10177.
- [4] O. M. Magnussen et al., J. Phys. Chem. 100(1996)5500.
- [5] H. Oji et al., J. Chem. Phys., 109(1998)10409.
- [6] C. Seidel et al., Phys. Rev. B, 64(2001)195418
- [7] L. Gao et al., Surf. Sci., 601(2007)3179.
- [8] K. Manandhar et al., J. Appl. Phys. 107(2010)063716.
- [9] J. Wenzel et al., J. Chem. Theory Comput. 10(2014)4583.

\* oendo@cc.tuat.ac.jp



図 1。金(111)面におけるペリレン単分子層の C K-NEXAFS スペクトル。



図 2。金(111)面における臭素(5 単位、本文参照)ドー ス後のペリレン単分子層の C K-NEXAFS スペクトル。



図 3。金(111)面におけるペリレン単分子層への臭素 ドースによる C K-NEXAFS スペクトル(GI)の吸収端 領域。



図 4。金(111)面におけるペリレン単分子層への臭素 ドース後 350 K へ加熱後の C K-NEXAFS スペクトル。



図 5。金(111)面におけるペリレン単分子層への臭素 ドース後 350 K および 450 K へ加熱後の C K-NEXAFS スペクトル(GI)の吸収端領域。